CLIPPEDIMAGE= JP362233266A

PAT-NO: JP362233266A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62233266 A TITLE: MANUFACTURE OF THERMAL HEAD

PUBN-DATE: October 13, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FUJIMAGARI, KEIJI

ASSIGNEE-INFORMATION: .

NAME

FUJI XEROX CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP61076329 APPL-DATE: April 2, 1986

INT-CL (IPC): B41J003/20 US-CL-CURRENT: 347/200

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a resist from cracking and obtain a thermal head having high reliability by providing a partial glaze layer in the vicinity of the peripheral part of a substrate.

CONSTITUTION: A substrate 101 is provided with shallow grooves 102 for splitting. Next, a partial glaze layer 103 is provided by screen printing. In this case, a partial glaze layer 103' is provided also at a peripheral part. A tantalum nitride layer is then deposited by sputtering. A heat generating resistor layer 104 is patterned by the application of a resist, exposure, etching and releasing of a resist pattern. After depositing a nichrome layer of 500Å thick and a gold layer by sputtering, an electrode conductor layer 105 is similarly patterned. Then, a silicon oxide layer and a tantalum pentoxide layer are provided as a protective layer 106 by

03/25/2002, EAST Version: 1.03.0002

sputtering. A thermal head thus produced has an extremely high reliability.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 233266

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)10月13日

B 41 J 3/20

111

H-7810-2C C-7810-2C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂発明の名称

サーマルヘッドの製造方法

②特 額 昭61-76329

经出 願 昭61(1986)4月2日

②発明者 藤曲

啓 志

海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社海老名事

業所内

⑪出 顋 人 富士ゼロツクス株式会

東京都港区赤坂3丁目3番5号

社

3代 理 人 弁理士 木村 高久

明報音

1. 発明の名称

サーマルヘッドの製造方法

2. 特許請求の範囲

1 基板上に多数個のサーマルヘッドを形成した 後、複数に分類するサーマルヘッドの製造方法に おいて、

発熱抵抗体層の形成に先立ちパターン形成領域に部分的にグレーズ層を形成するに限し、切除領域となる基板外周部にもグレーズ圏を付加形成するようにしたことを特徴とするサーマルヘッドの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産衆上の利用分野〕

本発明は、サーマルヘッドの製造方法に係り、 特に、1枚の基板から多数個のサーマルヘッドを 形成する方法に関する。

〔従来技術およびその問題点〕

従来、隷膜型のサーマルヘッドSは、第2図に その1例を示す如く、表面によりの電を形式が体層の してなるセラミック基板1上に発熱はしての のものとかの上層に1対の電積を設けるので のは、更にその上層に1対の電積を設けてので のは、要にしてなるもので表面は足を即かるので である。そしてなる。 によりその間に存在する。 によりその間に存在する。 を発力して、

しかしながら、このようなサーマルヘッドでは 発熱領域3 A が導電菌 4 の厚み分だけくほんだ例 道となるため、記録紙は発熱領域3 A に良好に接触し得ないことがあり、印字特性が良くないとい う問題があった。

そこで、第4回に示す如く、発熱領域30Aの下に部分グレーズ関11を配し、発熱領域を凸状にした構造のシリアルタイプのサーマルヘッドが

登案されている。 (特別 昭 5 6 - 1 5 9 1 7 6) かかる構造では記録紙が発熱領域 3 0 A に良好に接触するため、高品質の印字が可能となる。

ところで、このようなサーマルヘッドは、通常、 1枚の基板上に数十個同時に作り込まれ、後で分割するという方法がとられている。

例えば、まず機調からなるスクライブラインCの形成されたセラミック基板10上に、スクリーン印刷により、第5回に示す如く部分グレーズ圏11を形成した後、薄膜抵抗体圏のパターニング、オトリソ法による発熱抵抗体圏のパターニング、薄膜科体圏の成際の形成を程て多数個のパターニング、保護膜の形成を程で多数個のサーマルへッドを作り込む。そして、個々のシリアルタイプのサーマルへッドが形成される。

このように、薄膜型サーマルヘッドの形成工程では少なくとも2回のフォトリソ工程が必要である。このフォトリソ工程においては、このように部分グレース圏を形成した基板にレジストを塗布

き部位でのレジストの割れの発生はほとんど皆無 となる。

(実施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照しつの詳細に説明する。

第1回(a)乃至(g)は、本発明実施例のシリアルタイプのサーマルヘッドの製造工程を示す 図である。

まず、第1図(a)に示す如く、厚さ0.64 mm、大きさ52×52(mm)のアルミナ基板 101上に、分割用の浅溝(スクライブライン) 102を形成する。

次いで、第1回(b)および(c)に示す如く、スクリーン印刷法により部分グレーズ層103を形成する。このとき、外周部にも部分グレーズ層103′を形成する。(第1回(b)は第1回(c)のA-A斯面の拡大図に相当する。)

 した後露光する際パターン特度を維持するには、フォトマスクを基板に密着させなければならない。ところが密着した際に、部分グレーズ層11の存在する凸状部分特に外側の部分11′でレジストにひびが入ったりすることがあり、これが発熱低抗体層が分断あるいは、パターン寸法の縮小を誘起し歩留り低下の原因となっていた。

本発明は、前記実情に鑑みてなされたもので、フォトリソ工程におけるレジストの割れの発生を防止し、サーマルヘッドの製造歩留りを高めることを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

そこで本発明では、最終的には切除される領域 である基板の外周部にも予め、部分グレーズ圏を 形成するようにしている。

(作用

基板の外周部にも部分グレーズ圏を形成してお くことにより、露光工程におけるフォトマスクと の接触時のレジストの割れの多くは、切除部であ る外周部の部分グレーズ圏上で発生し、使用すべ

ッチング、レジストパターンの剥離を軽て発熱抵抗体 園 1 0 4 をパターニングする。 (第 1 図 (d))

更に、スパッタリング法により、膜 厚 5 0 0 A のニクロム (Ni Cr) 層および 1 . 5 mm の金 (Au) 層を堆積した後、フォトリソ法により、同様に電極導体関 1 0 5 をパターニングする。

そして、スパッタリング法により保護膜 1 0 6 として膜序 2 mの酸化シリコン (SiO₂₎膜、膜 厚 8 m の五酸化タンタル (Ta₂O₅₎膜を形成する (第 1 図(f))。

このようにして、アルミナ基板上に16個のサーマルヘッドを作り込んだ後、前記スクライブライン102に従って、分所する。(第1図(g))このようにして形成されたサーマルヘッドは、バターン設計の適りで極めて信頼性が高いものとなっており、製造歩留りも従来に比べて大幅に向上した。

なお、実施例では、基板の外周に8個の部分グレーズ図103′を付加したが、個数、位置、形

状等については、何ら実施例に限定されるもので はなく、外周部に部分グレーズ層を適宜付加する ようにすればよい。

また、各圏の材質についても実施例に限定されることなく適宜変更可能であることはいうまでもない。

(効果)

以上説明してきたように、本発明の方法によれば、部分グレーズ層を基板の外間部近傍にも形成するようにしているため、関徳部すなわち棄子形成部においてレジスト割れが発生してパターン糖度が低下することによる事留りの低下もなくなり、信頼性の高いサーマルヘッドを提供することが可能となる。

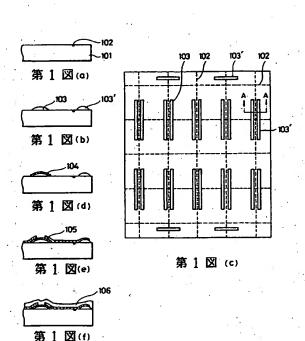
4. 図面の簡単な説明

第1回(a)~(g)は、本発明実施例のサーマルヘッドの製造工程図、第2回は、通常の誹謗型サーマルヘッドを示す図、第3回は、同サーマルヘッドを用いた印字監視を示す図、第4回は、

同静膜型サーマルヘッドの改良例を示す図、第5回は、第4回のサーマルヘッドの製造工程の1部 (グレーズ圏形成後)を示す図である。

101…アルミナ基板、102…スクライブ基板、103,103′…部分グレーズ層、 104…発熱抵抗体層、105…能極導体層、 106…保護層。

出版人代理人 木 村 高 久 宗河河 医原来



第1図(g)

